

(12) 按照专利合作条约所公布的国际申请

(19) 世界知识产权组织
国际局



(43) 国际公布日
2010 年 3 月 25 日 (25.03.2010)

PCT

(10) 国际公布号
WO 2010/031307 A1

- (51) 国际专利分类号:
H01J 37/16 (2006.01) H05H 1/00 (2006.01)
H01L 21/00 (2006.01)
- (21) 国际申请号: PCT/CN2009/073714
- (22) 国际申请日: 2009 年 9 月 3 日 (03.09.2009)
- (25) 申请语言: 中文
- (26) 公布语言: 中文
- (30) 优先权:
200810222421.3 2008 年 9 月 16 日 (16.09.2008) CN
- (71) 申请人 (对除美国外的所有指定国): 北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司 (BEIJING NMC CO., LTD.) [CN/CN]; 中国北京市朝阳区酒仙桥东路 1 号, Beijing 100016 (CN)。
- (72) 发明人: 及
- (75) 发明人/申请人 (仅对美国): 张风港 (ZHANG, Fenggang) [CN/CN]; 中国北京市朝阳区酒仙桥东路 1 号, Beijing 100016 (CN)。
- (74) 代理人: 北京天昊联合知识产权代理有限公司 (TEE & HOWE INTELLECTUAL PROPERTY ATTORNEYS); 中国北京市西城区西长安街 88 号首

都时代广场 7 层 718 室张天舒, Beijing 100031 (CN)。

- (81) 指定国 (除另有指明, 要求每一种可提供的国家保护): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW。
- (84) 指定国 (除另有指明, 要求每一种可提供的地区保护): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), 欧亚 (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), 欧洲 (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG)。

本国际公布:

— 包括国际检索报告(条约第 21 条(3))。

[见续页]

(54) Title: A PLASMA TREATMENT DEVICE

(54) 发明名称: 等离子体处理设备

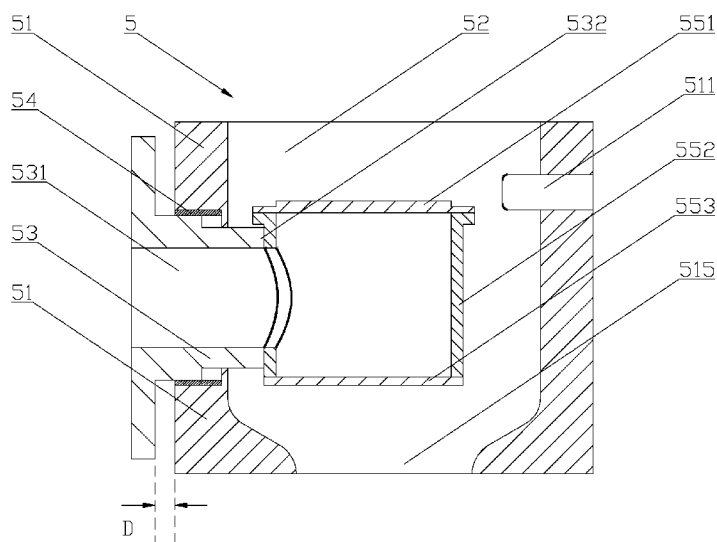


图 5 / Fig. 5

(57) Abstract: A plasma treatment device (5) comprises an outer shell (51) which is provided with a reaction chamber (52) in the interior, a bottom electrode which is arranged in the reaction chamber (52) and a cantilever support device (53) which goes through the outer shell (51) and which supports the bottom electrode. The cantilever support device (53) is pivotally arranged at the side wall of the outer shell (51) and can independently rotate in the outer shell (51). The plasma treatment device (5) further comprises a location device so as to selectively fix the relative position of the cantilever support device (53) and the outer shell (51).

[见续页]

WO 2010/031307 A1

(57) 摘要:

一种等离子体处理设备(5)，包括内部具有反应腔室(52)的外壳体(51)、设于所述反应腔室(52)中的下电极以及贯穿所述外壳体(51)并支撑所述下电极的悬臂支撑装置(53)；所述悬臂支撑装置(53)枢装于所述外壳体(51)的侧壁且能够在所述外壳体(51)中自转；所述等离子体处理设备(5)进一步包括定位装置，以便可选择地固定所述悬臂支撑装置(53)与所述外壳体(51)的相对位置。